

GDS Snapshot

Ni/Cr 薄膜深さプロファイルスタンダード
-定量深さプロファイル分析

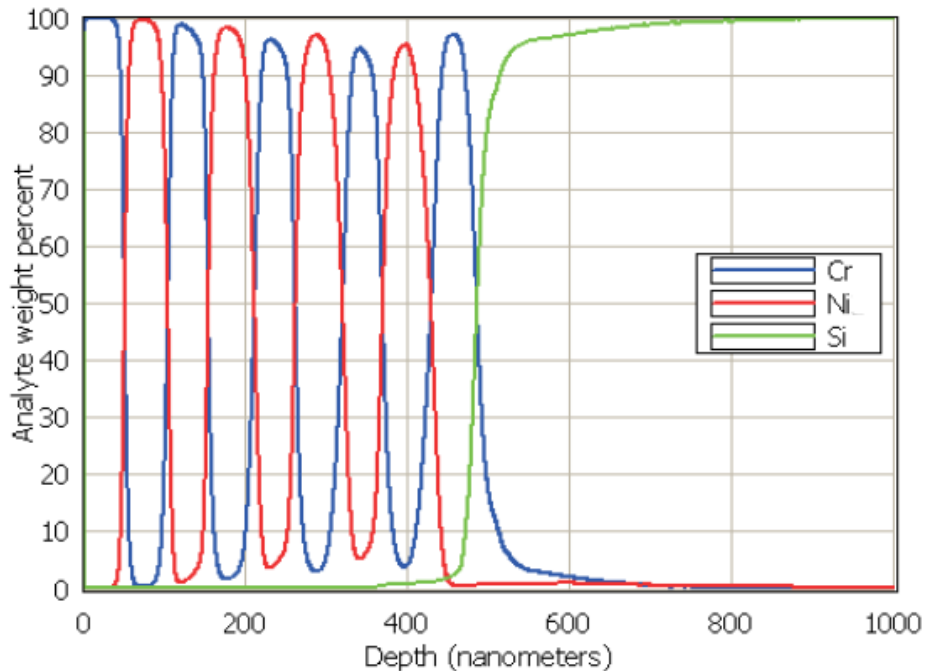

分析条件

| | |
|------------|--------------------------------|
| 装置 | LECO GDS850A |
| 分析元素 | Cr, Ni, Si |
| ランプ | Grimm-style RF 4mm ランプ |
| オペレーティング条件 | 30mA, 1000V |
| プロファイリング時間 | 表層 <10s, 1000/s, トータルアナリシス 30s |
| サンプル | NIST2135 |

分析例

GDS850A による薄膜スタンダードの分析。認証値 Cr=206.3±13.8 μg/cm³、Ni=197.4±9.6 μg/cm³

公証厚さ Ni 層 57nm, Cr 層 56nm



| Cr1, nm | Ni1, nm | Cr2, nm | Ni2, nm | Cr3, nm | Ni3, nm | Cr4, nm | Ni4, nm | Cr5, nm | Cr μg/cm ² | Ni μg/cm ² |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 60 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 57 | 61 | 64 | 213.6 | 196.1 |